

UltraScience Pico Plus Western ECL Substrate 取扱説明書

型番	容量	使用量（ゲル使用枚数）
CCH321-B100ML	50ml x 2	・ 目安 4ml／枚 （25 枚分） 2ml／枚 （50 枚分） ※メンブレンサイズ 8 x 7cm

保存方法：4℃ 保存期間：1年

【製品について】

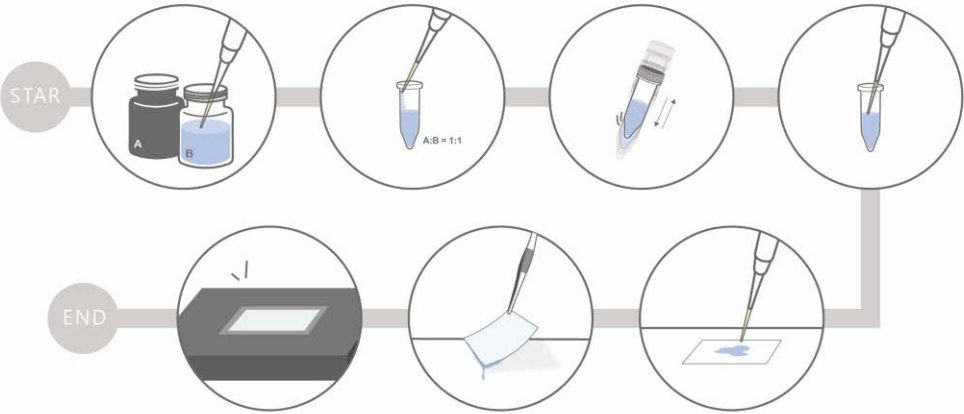
ルミノールベースの化学発光基質として UltraScience Pico Plus Western ECL Substrate は、西洋ワサビペルオキシダーゼ（HRP）結合二次抗体を用いたイムノプロットに対して感度が高く、適合性があります。抗体の低ピコグラムおよび高フェムトグラムの検出は、UltraScience Pico Plus Western ECL Substrate の優れた感度と長いシグナル持続時間によって検出が可能になります。さらに、その長い化学発光シグナルの持続時間は、シグナルの損失なしに、デジタルおよびフィルムベースのイメージングを可能にします。最適なシグナル強度および持続時間を得るためには、適切な一次および二次抗体希釈が必要です。

- ・ 他社製品から切り替える際は、最適化やプロトコールの変更は必要ありません。
- ・ ウェスタンブロッティングマーカーと互換性があります。

【使用方法】

1. 基質混合液を調整しながら、メンブレンが乾燥しないように洗浄緩衝液中に湿らせておきます。
2. ルミノール溶液と過酸化物質溶液を 1：1 の割合で混合し、化学発光基質溶液を十分に攪拌して調製します。

（8 x 7cm のメンブレンサイズの場合、4 ml の溶液量で十分です。）
3. メンブレンを平らな表面または清潔な容器にタンパク質側を上にして置き、化学発光基質溶液で浸します。
4. メンブレンを溶液から取り出し、余分な液体を排出します。
5. 目的に応じて、イメージャーなどで撮影をし、メンブレンを画像化します。



【トラブルシューティング】

問題	原因	解決
高いバックグラウンド	一次または二次抗体の濃度が高い	・ 抗体濃度を下げる ・ ドットプロット法で最適化する
	洗浄が不十分	・ 洗浄液を交換しながら、洗浄時間を増やす
	ブロッキングが不十分	・ 抗体濃度を下げる ・ ドットプロット法で最適化する
シグナルが弱い 反応なし	抗原の結合が不十分	・ 抗体濃度を下げる ・ 感度と特異性のバランスをとるためのブロッキング試薬の最適化
	抗原に結合する抗体が不足している	・ 抗体に使用する溶液を最適化する ・ 抗体インキュベーション時間を長くする
	アッセイ中にメンブレンからタンパク質が抜けた	・ 洗浄の回数や揺動強度を減らす
	試薬の量が不十分	・ 抗体ブロッキング溶液を増やす

※本製品は試験研究用です。



ジェレックスインターナショナル株式会社

〒194-0037 東京都町田市木曽西 4-8-48

TEL: 042-792-3981 FAX: 042-792-3982

info@gellex.jp